科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成24年 6月 7日現在

機関番号:82110 研究種目:若手研究(E 研究期間:2009~2011 課題番号:21760709	3) I		
研究課題名(和文)	加速レンズ系による負の収差の制御技術に関する研究		
研究課題名(英文)	Study on Negative Aberration Control in Acceleration Lens System		
研究代表者 大久保 猛(OHKUBO TAKERU) 独立行政法人日本原子力研究開発機構・放射線高度利用施設部・研究員 研究者番号:40446456			

研究成果の概要(和文):ナノテク分野での微細加工ツールとして切望されているガスイオンナ ノビームの普及に不可欠な装置の小型化を実現すべく、加速レンズ系内に減速レンズを挿入す ることによってビーム径の縮小化に有効である収差を制御する技術を開発した。

研究成果の概要(英文): The aberration control technology which is effective in reduction of a beam diameter was developed by adding a deceleration lens to an acceleration lens system. The compact lens system to form gaseous ion nanobeam will be a great tool for applications in nanofabrication.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2009 年度	500,000	150,000	650,000
2010 年度	1,400,000	420,000	1, 820, 000
2011 年度	500,000	150,000	650,000
年度			
年度			
総計	2, 400, 000	720,000	3, 120, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:総合工学、原子力学 キーワード:放射線工学・ビーム科学

1. 研究開始当初の背景

近年、1µm 程度のビーム径を持つイオンビ ーム、いわゆるマイクロビームが、静電加速 器やサイクロトロンで加速されたガスイオ ンのビームを集束して形成され、微細な加 工・分析等に利用されている。このようにイ オンを加速した後に集束する従来方式では、 レンズ系の物点距離を可能な限り長くとっ てはいるが、縮小率は高々数 10 倍である。 一方、一般に表面加工等に用いられている FIB(Focused Ion Beam)は小型ナノビーム形 成装置であるが、物点の極小化が容易な液体 金属イオン源(主にガリウム)を用いるため、 加工材料中に有害なガリウムが残留することが不可避であり、無害かつ多種多様なガス イオンのナノビームが期待されている。現在 開発中の新たなイオンビーム集束技術であ る加速レンズ方式では、低エネルギーのイオ ンビームを高エネルギーへ加速しながら集 束することによって従来のレンズ系に比べ て大きな縮小率を短い距離で得ることが可 能である。これまでに、物点 200 µ m 径に対 して 300mm長の加速レンズ系で 46keV 水素 分子イオンのナノビームが形成され、ビーム 径 160nm、ビーム電流 100pA、縮小率 1250 倍が達成されている。 2. 研究の目的

ガスイオンナノビームはナノテクへの応用 が切望されているが普及には装置の小型化 が不可欠である。研究の全体構想は、ビーム の加速・集束を同時に行う加速レンズ系で大 きな縮小率を達成し、その後段に配置する加 速管との一体型加速集束レンズ系とするこ とによりビーム径 10nmの MeV 級小型装置 を開発することであるが、この場合、加速管 で生じる収差がビーム径の縮小を妨げる。そ こで本研究では、後段の加速管で生じる収差 を打ち消すことを目的とし、前段の加速レン ズ系内に減速レンズを導入することによっ て負の収差を制御する技術を開発する。

3. 研究の方法

(1)後段の加速管で生じる収差を前段の加速 レンズ系で負の収差を制御することによっ て打ち消すことができる条件をイオン光学 シミュレーションによって追究した。効率的 に条件追究を進めるべく計算時間の短縮の ため、計算コードを本研究で開発している加 速レンズ系に最適化した。

(2)イオン光学シミュレーションによって得られた収差の制御によるビーム径の縮小化 を実験によって実証するべく、新たな加速レンズ実験体系の構築を行った。収差制御を行う第二加速レンズには減速電圧印加用に新たな電極を配置した。この実験体系を使用してビーム集束実験を行った。

4. 研究成果

(1)加速レンズ系は円柱対称系であること、 イオンが中心軸の近傍を進行すること、磁場 が存在しないこと、以上の3点を考慮するこ とによって、計算コードの簡略化と計算時間 の短縮化に成功した。その計算コードを用い て負の収差による全体系の収差の打ち消し 条件を追究した結果、加速レンズ系出口で形 成される 46keV 水素分子イオンビームに対し て新たに付加する減速電圧が 15kV の時に、 負の収差によって加速レンズ系の収差が最 大 26%低減し(図1参照)、ビーム径を最大 17%縮小できることがわかった(図2、図3 参照)。以上の成果により、加速レンズ系と 加速管との一体型装置において、減速電圧に よる負の収差を制御することによって収差 が打ち消され、ビーム径をより小さく集束で きる見通しが得られた。



(2) 図4及び図5に新たに構築した加速管 一体型加速レンズ系を示す。後段に配置する 加速管に印加する電圧として 300kV を想定し ているが、加速レンズ系に高電圧を印加する と電圧勾配が非常に大きいために放電が頻 繁に発生することがわかった。レンズ系全体 に対して 150kV 以上印加すると、加速レンズ 装置と周辺の間の絶縁破壊やコロナ放電、周 辺物品のチャージアップや高圧電場による 計測機器へのノイズ混入など、ビーム形成及 びその計測における不安定性が複数生じる ことがわかった。そこで、例えば装置周辺の チャージアップに起因するノイズ電場から 電流測定用端子をシールドする等、不安定性 の原因を一つ一つ特定して解消したことに よって、200kV でのビーム電流計測が可能に なり、ビーム電流 10pA 程度、ビーム径 20μm 程度への集束に成功した。研究実施計画では、 収差制御の有効範囲であるビーム径サブミ クロンまでの集束を行うことになっていた が、そのためには今後さらに加速レンズ系内 のコンディショニング (クリーニング)を継 続しながらビーム形成及びビーム径計測の 安定性を高める必要があることがわかった。 しかしながら、現段階において減速レンズ部 には最大で 40kV 程度を安定に負印加できる ことを確認しており、イオン光学シミュレー ションによって得られた収差制御によるビ ーム径縮小化の最適条件である減速電圧 15kV を負印加することは十分に可能である と結論付けられる。



図4:加速管一体型加速レンズ系の外観



図5:加速管一体型加速レンズ系の概略図

以上、3年間の研究目標であった減速レンズ による収差制御技術をほぼ確立した。今後サ ブミクロン径ビームを形成した後、更なる縮 小化のために収差制御技術を適用する予定 である。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

①<u>T. Ohkubo</u>, Y. Ishii and T. Kamiya、 Theoretical Approach Of The Reduction Of Chromatic And Spherical Aberrations In An Acceleration Lens System For Hundreds Of keV Gaseous Ion Nanobeam、AIP Conference Proceedings、査読有、vol.1336、2011、 pp.176-180、 DOI: 10.1063/1.3586083

〔学会発表〕(計4件)

①<u>大久保猛</u>、ガスイオンナノビーム形成装置
小型化のための加速管一体型レンズ系開発、
日本原子力学会 2009 年秋の大会、2009/09/17、
東北大学

②大久保猛、300kV 小型ガスイオンナノビー

ム形成装置のレンズ系開発、日本物理学会第 65回年次大会、2010/03/21、岡山大学

③<u>Takeru Ohkubo</u>, Theoretical Approach of the Reduction of Chromatic and Spherical Aberrations in an Acceleration Lens System for Gas-FIB to Form Gaseous Nanobeam, 21st International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry (CAARI2010), 2010/8/10, Fort Worth, Texas, USA

④大久保猛、ガスイオンナノビーム形成のための 300kV 小型装置の構築、日本原子力学会 2011 年秋の大会、2011/9/21、福岡県北九州市

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 〇出願状況(計0件)

○取得状況(計0件)

〔その他〕 ホームページ等

6. 研究組織

(1)研究代表者

大久保 猛 (OHKUBO TAKERU) 独立行政法人日本原子力研究開発機構・放 射線高度利用施設部・研究員 研究者番号:40446456

(2)研究分担者

なし

(3)連携研究者 なし